

RF Magnetron Sputter에 의해 제조된 ITO/Ag/AZO 다층박막의 전기적·광학적 특성

김민환, 안진형, 김상호

한국기술교육대학교 신소재공학과

Abstract

ITO/Ag/AZO and AZO/Ag/ITO multi-layer films deposited on glass substrate by RF magnetron sputtering have a much better electrical properties than ITO and AZO single-layer films. The multi-layer structure was consisted of three layers of ITO, Ag and AZO. The optimum working pressure of AZO layers deposition was determined to be 1.0×10^{-2} torr for high optical transmittance and good electrical conductivity. The electrical and optical properties of sub/ITO/Ag/AZO were higher than those of sub/AZO/Ag/ITO multi-layer films.

Keywords : ITO, AZO, Ag, RF magnetron sputtering, Optical transmission, Sheet resistance

1. 서론

ZnO 박막은 상온에서의 증착이 가능하며 원자재가 저가이고 플라즈마에 대한 안정성이 우수한 장점으로 인해 현재 LCD, PDP, OLED 등의 차세대 디스플레이 장치의 투명전극으로 주로 사용되고 있는 ITO 전극을 대신할 수 있는 투명전도체로 각광받고 있다. 또한 Al-doped ZnO (AZO) 박막의 경우 ZnO 박막에 비해 전기적 특성이 뛰어난 장점을 가지고 있다. 기존의 ITO 및 AZO 단층 박막의 전기적 광학적 특성을 개선하기 위한 노력으로 Ag 박막을 전체 박막의 중간에 삽입시키는 ITO/Ag 및 AZO/Ag 다층구조에 대한 연구개발이 활발하게 이루어지고 있다. 본 실험에서는 ITO/Ag 박막과 AZO/Ag 박막의 광학적 특성을 개선하기 위하여 소다라임 유리기판 위에 ITO/Ag/AZO 다층박막과 AZO/Ag/ITO 다층박막을 RF 마그네트론 스퍼터링 장치를 이용하여 제작함에 있어, AZO 의 증착 압력에 따른 전기적 광학적 특성을 살펴보고 증착된 박막이 투명전극으로 쓰이기에 알맞은 낮은 면저항과 높은 광 투과율이 관찰되는 조건을 찾아 그 원인을 분석하여 보았다.

2. 실험 방법

본 실험에서는 ITO/Ag/AZO 다층 박막과 AZO/Ag/ITO 다층 박막을 RF magnetron sputter 를 이용하여 소다라임 유리 기판에 증착하였다. 초기 진공도는 로터리 펌프와 확산 펌프를 이용하여 1.2×10^{-5} torr 을 유지하였고 sputtering target 은 직경과 두께가 각각 2 in, 1/4 in size의 AZO (Al_2O_3 2wt.% + ZnO 98wt.%)와 Ag (99.95%), 그리고 ITO (In_2O_3 90wt.% + SnO_2 10wt.%)를 사용하였다. Target 의 표면 세정을 위하여 AZO target 은 15분, Ag target 은 10분, ITO target 은 15분 동안 각각 pre-sputter 를 실시하였다. 소다라임 유리 기판은 초음파 세척기를 이용하여 acetone 과 ethanol 중에서 각각 10분씩 세척하고 증류수를 이용하여 린스 후 질소 가스로 건조 시켰다. Target 과 substrate 와의 거리 (T-S 간격)는 65 mm 로 유지하였으며, 증착시 온도는 실험실 온도에서 실시하였다.

AZO 박막은 RF power 60W, 증착 두께 1000 Å 으로 고정하고 증착압력을 1.1×10^{-1} torr 에서 3.7×10^{-3} torr 으로 변화시켜 증착하였으며 ITO 박막은 RF power 80W, 증착압력 4.0×10^{-3} torr, 증착 두께 1000 Å 으로 증착하였다. 또한 투명 전도체 산화물인 ITO 와 AZO 박막 사이에 Ag 박막을 RF power 60W, 증착압력 3.0×10^{-3} torr 두께 100 Å 의 조건으로 형성시켜 총 3 층으로 구성된 ITO/Ag/ITO 다층 박막의 적층 순서 및 AZO 박막의 증착 압력에 따른 전기적 광학적 특성의 변화를 살펴보았다.

분석을 위하여 사용한 장비는 증착 막의 두께를 측정하기 위하여 surface profiler (Tencor, P-2)를 이용하였으며 광학적 특성을 평가하기 위하여 UV spectrophotometer (Varian, cary-500)를 이용하여 광 투과율을 측정하였다. 성막된 ITO/Ag/AZO, AZO/Ag/ITO 다층 박막의 결정구조를 알아보기 위하여 X-ray diffraction (Rigaku, RTP 300 RC) 측정을 실시하였고 전기적 특성을 평가하기 위하여 4-point probe (Guardian, 402S)와 hall effect measurement (Ecopia, HMS-3000) 를 이용하여 각각 면저항과 비저항 및 캐리어 농도와 훌 이동도를 관찰하였다.

3. 실험결과 및 고찰

3.1 적층순서 최적화

그림 1은 예비실험을 통하여 우수한 막 특성을 나타낸 RF power 80W, 증착압력 3.0×10^{-1} torr, 증착두께 1500 Å 에서 증착된 ITO 박막과 RF power 60W 증착두께 1000 Å 에서 증착된 AZO 박막 사이에 Ag 박막을 RF power 60W, 증착압력 3.0×10^{-3} torr 의 조건에서 증착한 ITO/Ag/AZO 다층 박막 및 AZO/Ag/ITO 다층 박막의 AZO 증착압력에 따른 투과율을 나타낸 것이다. 투과율 그래프에서 알 수 있듯이 ITO 가 최상층으로 올라온 다층 박막의 경우는 가시광선 영역 대에서 70%미만의 낮은 광 투과율을 나타냈으며 AZO 가 최상층으로 올라온 다층 박막의 경우는 AZO의 증착압력에 따라 투과율이 급격하게 변화하였으며 1.0×10^{-2} torr 에서 가장 좋은 광 투과율이 관찰되었다.

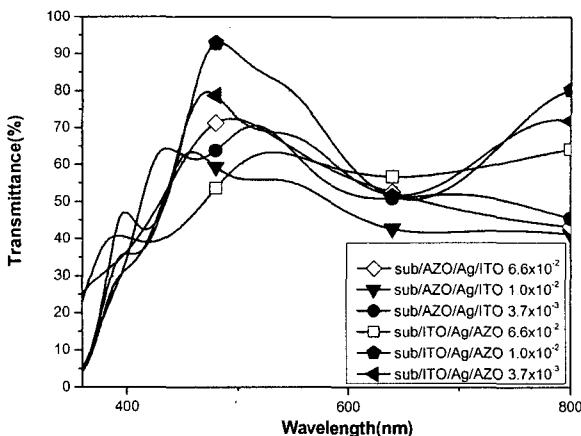


Fig. 1 Optical transmittance of ITO/Ag/AZO and AZO/Ag/ITO films at a visible rays

전기적 특성의 경우 역시 가장 상층에 AZO 박막이 형성 되었을 경우가 ITO 박막이 형성 될 경우에 비하여 높은 특성을 나타내었고 AZO의 증착 압력 1.0×10^{-2} torr에서 면저항 $6.8 \Omega/\square$, 비저항 $1.05 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ 으로 가장 좋은 전기적 특성을 나타내었다 이를 표 1에 나타내었다.

Table 1. Electrical properties of ITO/Ag/AZO and AZO/Ag/ITO films

	Working Pressure	Sheet Resistance (Ω/\square)	Resistivity ($\Omega\text{ cm}$)
sub/ITO/Ag/AZO	6.6×10^{-2}	11	1.868×10^{-4}
	1.0×10^{-2}	6.8	1.054×10^{-4}
	3.7×10^{-3}	10.2	1.543×10^{-4}
sub/AZO/Ag/ITO	6.6×10^{-2}	22.5	5.108×10^{-4}
	1.0×10^{-2}	36	1.555×10^{-3}
	3.7×10^{-3}	11.3	2.440×10^{-4}

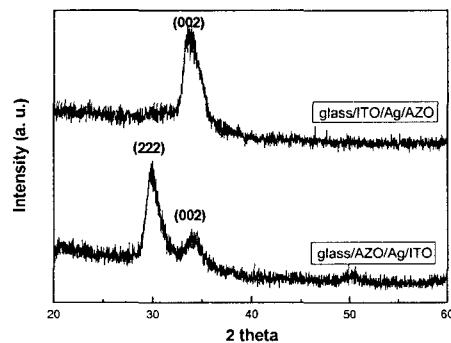


Fig. 2. X-ray diffraction patterns of ITO/Ag/AZO and AZO/Ag/ITO films

그림 2는 AZO/Ag/ITO 다층박막과 ITO/Ag/AZO 다층박막의 AZO 증착압력 1.0×10^{-2} torr에서 X선 회절분석의 결과를 나타낸 것이다. 주 배향면은 ITO가 가장 상층으로 올라온 시편은 (222) 배향을 나타냈고 낮은 강도의 (002) 배향도 관찰되었으며 AZO가 상층으로 올라온 경우는 (002) 배향만 관찰되었다.

3.2 AZO 증착압력에 따른 전기적 광학적 특성

그림 3은 AZO가 가장 상층에 위치한 ITO/Ag/AZO 박막의 AZO 증착압력의 변화에 따른 광 투과율 스펙트럼을 나타낸 그래프이다. AZO 증착압력 3.0×10^{-2} torr ~ 7.0×10^{-3} torr에서 높은 광

투과율을 나타냈으며 이중 1.0×10^{-2} torr에서 가장 높은 투과율이 관찰되었고 80%이상의 투과율 영역을 가지는 범위는 3.0×10^{-2} torr에서 가장 넓게 나타났다.

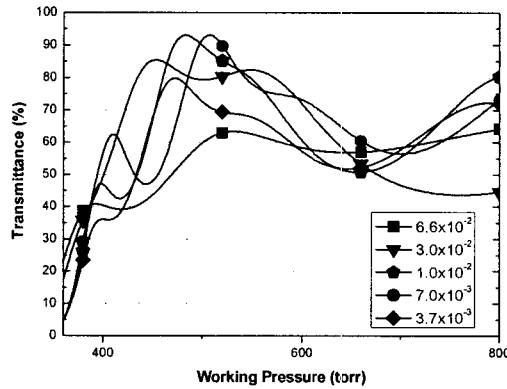


Fig. 3. Optical transmittance of ITO/Ag/AZO films with different working pressure of AZO layers

AZO의 종착압력의 따른 면저항 및 비저항의 변화와 캐리어 밀도 및 이동도의 변화를 그림 4 와 5에 각각 나타내었다. 면저항 및 비저항은 거의 같은 양상으로 변화하고 있음을 확인할 수 있으며 중간에 Ag가 종착이 된 다층박막의 특성상 최고치와 최저치의 차이가 작은 전체적으로 우수한 전기적 특성을 관찰 할 수 있었다. 캐리어 밀도는 압력이 낮아질수록 큰 변화 양상을 보이지 않으나 3.7×10^{-3} torr에서 급격한 증가치를 보였으며 이때의 이동도는 다른 압력에서의 이동도와 비교하였을 때 급격히 저하되는 특성을 보여 전체적인 비저항은 크게 변화하지 않았다. Ag가 삽입된 다층박막의 경우에는 캐리어의 농도와 훌 이동도가 조화를 이루어 전체적으로 높은 전기적 특성이 나타난 것으로 사료된다.

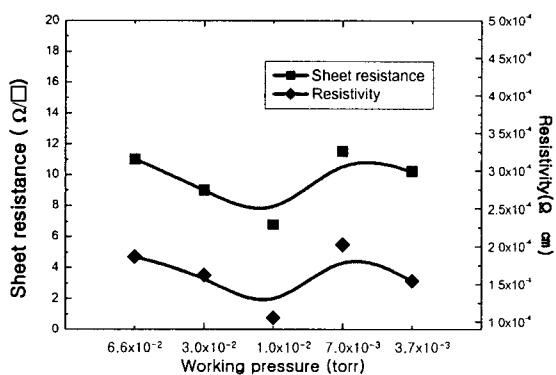
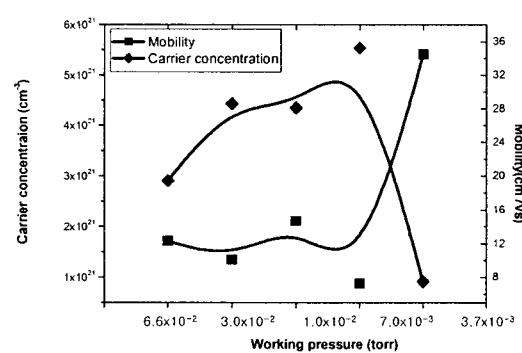


Fig. 4. Electrical properties of ITO/Ag/AZO films with different working pressure of AZO layers Fig.



5. Carrier concentration and mobility of ITO/Ag/AZO films with different working pressure of AZO layers

ITO/Ag/AZO의 3층으로 구성된 다층박막의 경우 AZO가 가장 상층에 위치한 ITO/Ag/AZO 구조에서 AZO의 증착압력이 1.0×10^{-2} torr 일 때 상대적으로 우수한 전기적 특성 및 광학적 특성이 관찰되었다. 일반적으로 금속이 중간층에 삽입된 다층박막 구조를 가지는 투명 전도체 산화물의 경우 광 투과율 특성 및 전기적 특성은 금속층의 두께와 금속층 위에 증착되는 투명 전도체 산화물의 종류 및 증착 조건과 밀접한 관계를 가지고 있다. Ag 단층박막의 경우 Ag 박막의 두께가 증가할수록 Ag 층이 bulk와 같은 특성을 나타내며 광 흡수 및 표면산란, 반사등으로 투과율이 감소하게 되나, Ag 단층박막과 달리 ITO/Ag/AZO 다층박막의 경우 Ag의 두께 변화에 따라 Ag 층의 구조가 섬 구조에서 연속적인 박막 형태로 변화하게 되고 이에 따라 상층 AZO의 증착조건 변화에 광 투과율 및 전기적 특성이 많은 영향을 받게 된다. 따라서 Ag의 두께를 고정하지 않고 변수를 두었을 경우의 전기적 광학적 특성은 앞서 열거된 데이터와 다른 양상을 보일 것으로 예상된다.

4. 결론

본 실험에서 glass 기판 위에 ITO/Ag/AZO 및 AZO/Ag/ITO 다층박막의 증착시 AZO 압력에 따른 광학적 전기적 특성 변화를 관찰하고 최상의 증착조건을 찾은 결과는 다음과 같다.

대표적인 투명 전도체 산화물인 ITO 와 AZO 이용한 다층박막의 경우 AZO가 가장 상층에 위치하는 ITO/Ag/AZO 구조가 ITO가 상층에 위치하는 AZO/Ag/ITO 구조에 비해 높은 전기적 특성과 광학적 특성을 나타냈다.

AZO가 가장 상층에 위치하는 ITO/Ag/AZO 구조에서 AZO의 증착압력을 변화시켰을 때 3.0×10^{-2} torr ~ 7.0×10^{-3} torr에서 우수한 광학적 특성을 나타냈으며 전기적 특성의 경우 AZO의 증착압력과 관계없이 모든 시편에서 우수한 결과를 나타내었다.

참고문헌

- [1] T. Minami, S. Suzuki and T. Miyata, "Thin Solid Films", 398-399, p. 53, 2001.
- [2] M. Chen, Z. L. Pei, X. Wang, C. Sun and S. Wen, J. Vac. sci. Technol. A19, p. 963, 2001.
- [3] J. L. Vossen, Physics of thin films Vol. 9, Academic Press, New York, p. 35, 1977.
- [4] M. Yamamoto and T. Namioka Appl. Opt. 31 10, p. 1612, 1992.
- [5] C. Charlton, M. Fahland, to be published in Proceedings of Conference on Plasma and Surface Engineering (PSE), 2000.